## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

07212031

**PUBLICATION DATE** 

11-08-95

APPLICATION DATE

25-01-94

APPLICATION NUMBER

06006575

APPLICANT :

NIPPON DENNETSU KEIKI KK;

INVENTOR:

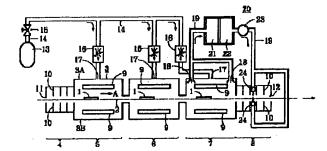
IMAI MASAAKI;

INT.CL.

H05K 3/34

TITLE

SOLDERING DEVICE



ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a soldering device on which the sealability of the atmosphere in a chamber can be enhanced while the amount of consumption of inert gas is being suppressed to the minimum, and also excellent soldering environment can be obtained at low running cost by retaining the oxygen concentration and the temperature in a stable manner.

> CONSTITUTION: A gathering device 20, which removes the flux fume present in the atmosphere in the chamber 3 where an inlet 11 used to carry in a wiring board 1 and an outlet 12 used to carry out the wiring board 1 are formed, is provided and also a nozzle 24, which forms a gas curtain used to seal at least the side of outlet 12 of the chamber 3 by jetting out the flux-fume-removed gas by the gathering device 20, is provided.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-212031

(43)公開日 平成7年(1995)8月11日

(51) Int.Cl.6

H 0 5 K 3/34

識別記号

507 J 8718-4E

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全8頁)

(21)出願番号

特願平6-6575

(22)出願日

平成6年(1994)1月25日

(71)出願人 000232450

日本電熱計器株式会社

東京都大田区下丸子2丁目27番1号

(72)発明者 今井 正昭

横浜市港北区新吉田町157番地 日本電熱

计器株式会社横浜工場内

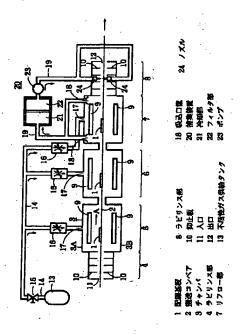
(74)代理人 弁理士 小林 将高

## (54)【発明の名称】 はんだ付け装置

### (57)【要約】

【目的】 不活性ガスの消費量を最小限に抑えつつ、チャンパ内の雰囲気の封止性を高めるとともに、酸素濃度や温度を安定に保持することによって優れたはんだ付け環境を低ランニングコストで可能とするはんだ付け装置を得る。

【構成】 配線基板1が搬人される人口11と配線基板1が搬出される出口12とが形成されたチャンパ3内の雰囲気中に滯留するフラックスヒュームを除去する捕集装置20を備え、捕集装置20でフラックスヒュームが除去された体を噴出して少なくともチャンパ3の出口12輌を封止するガスカーテンを形成するノズル24を設けたことを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【曽求項 1】 チャンパ内の雰囲気ガス中に滞留するフラックスヒュームを除去する捕集装置を備えたはんだ付け装置において、

前記捕集装置から排出されるフラックスヒューム除去後 のガス体を噴出して、ガスカーテン形成するノズルを備 えたことを特徴とするはんだ付け装置。

【請求項2】 配線基板が搬入される入口と、前記配線 基板が搬出される出口とが形成されたチャンパ内の雰囲 気中に滞留するフラックスヒュームを除去する捕集装置 10 を備えたはんだ付け装置において、

前配捕集装置から排出されるフラックスヒューム除去後 のガス体を噴出して、少なくとも前記チャンパの出口側 を封止するガスカーテンを形成するノズルを備えたこと を特徴とするはんだ付け装置。

【簡求項3】 捕祭装置は、雰囲気を冷却するための冷却部を有することを特徴とする前求項1または2に記載のはんだ付け装置。

【翻求項5】 ノズルは長尺状の管体からなり、ガス噴出用の針状の孔が所定間隔で形成されるとともに、前記ガス噴出用の孔が上下に対向する向きで、その長手方向が互いに水平方向で120mm以下の間隔で配設され、他方、フラックスとュームの捕集装置を介してチャンパ内の雰囲気ガスを吸引して前記ノズルから吐出するガス 30体の吐出辞圧が800mmAq以上の出力を有するボンブを備えたことを特徴とする翻求項1ないし4のいずれかに配贷のはんだ付け装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、雰囲気を封止したチャンパ内で配線基板のはんだ付けを行うはんだ付け装置に 40 関するもので、特に、チャンパの入口や出口等にガスカーテンを形成して雰囲気の封止性を向上させるようにしたものである。

#### [0002]

【従来の技術】電子部品を搭載したプリント基板のはんだ付けを、酸素過度の低い不活性ガス穿囲気中で行うはんだ付け装置が用いられている。また、不活性ガスとしては一般的に窒素ガス(N<sub>1</sub>)が使用されている。

【0003】すなわち、このことによって配線基板のは んだ付けランドや電子部品のはんだ付け電極等の酸化が 50 抑制され、少量のフラックスでも良好なはんだ付けが可能になるとともに、はんだ融液の表面張力が低下して、いわゆるマイクロソルダリングが可能となる。また、はんだ融液中の鉛の蒸発・拡散が抑制され、鉛による大気汚染を解消することができる。

【0004】一方、はんだ付け工程ではフラックスヒュームが発生するが、努囲気の封止を目的としたチャンパ内ではんだ付けを行うはんだ付け装置においては、フロー型およびリフロー型を問わずフラックスヒュームがチャンパ内に滞留することになる。そこで、雰囲気中に滞留するフラックスヒュームのような不純物を捕集して除去する装置を備えたはんだ付け装置が一般化している。

【0005】例えば、実公平3-15253号公報の技術、特開平4-13474号公報の技術、特開平4-46667号公報の技術または実開平5-87987号公報の技術等がある。すなわち、これらの技術は、チャンパ内の雰囲気ガスを循環させる循環路を設け、この循環路にフラックスヒュームを捕集するためのフィルタや冷却器を備えたところに特徴がある。また、フラックスヒューム除去後の雰囲気ガスを再加熱してチャンパ内に還流させる技術も説明されている。

【0006】他方、チャンパの封止性を向上させるため に、チャンパの入口や出口に窒素ガス等のガスカーテン を形成する技術が用いられている場合がある。

【0007】例えば、実開昭63-189469号公報の技術、特開平1-118369号公報中に配成された技術、実開平3-31087号公報の技術または特開平4-37366号公報の技術等である。すなわち、これらの技術は、窒素ガス等の不活性ガスをガスカーテン形成用ノズルから噴出させ、チャンパ外の大気に対するチャンパ内雰囲気ガスの封止性を向上させた技術である。

【0008】なお、これらのガスカーテン技術は、ガスタンク等のガス供給手段から高圧の窒素ガスをノズルに供給して構成する技術である。そのため、孔径の小さいノズルをガスカーテン形成用ノズルとして用いる。

【0009】他方、開口面積が大きく、例えば、スリット状のノズルを使用してガスカーテンを形成する技術もある。図5は低圧型のポンプ、例えばブロア等でノズルにガスを供給してガスカーテンを形成する際に使用するノズルの従来例を示す斜視図である。この図において、51はノズルで、長尺状で上下一対のパイプ52からなり、パイプ52はガス噴出用のダクト状スリット53が対向して形成されている。

【0010】このような構成において、吐出停圧の低いポンプではノズル51から噴出するガスの噴出速度も小さい。そのため、スリット53の開口面積を大きくすることで噴出するガスの量を多くし、結果としてガスの到途距離を長くできるように構成し、ガス噴出速度が小さくなることによるカーテン作用の低下(封止性の低下)を補った例である。このような例は、噴出ガスとして大

--192--

気を使用したエアカーテンに広く使用されている。

【0011】さらに、上記ガスカーテン技術の他に、特 開平5-185272号公報のガスカーテン技術がある。すなわち、チャンパの入口から潤出した不活性ガス からなる雰囲気を吸引して出口側にガスカーテン用とし で噴出することにより還流使用し、出口側から潤出した 不活性ガスからなる雰囲気を吸引して入口側にガスカーテン用として噴出することにより還流使用した技術である。この技術の特徴は、上記のような雰囲気の供給およびガスカーテン形成技術の他に、ガスカーテンを形成す 10 る予備室を設けているところにあり、この予備室の存在 が雰囲気の漏出を抑制するための緩衛 (パッファ)室と なっている。

#### [0012]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来のフラックスヒューム除去技術やガスカーテン形成技術には、次のような問題がある。

【0013】すなわち、雰囲気の循環路でフィルタリングによってフラックスヒュームを除去する際に雰囲気が冷却しやすくなり、チャンパ内に還流した際にチャンパク雰囲気の温度を低下させる外乱要因として作用してしまう。このことは、特に、リフロー型はんだ付け装置においては致命的である。そこで、雰囲気の再加熱を行ってからチャンパ内へ還流させる必要が生じている。特に、冷却によってフィルタリングを行う技術においては必要条件となっている。

【0014】他方、従来のガスカーテン技術においては、窒素ガス等の不活性ガスの生ガスをそのまま供給しているので、はんだ付け装置全体のガス消費量が大きくなり、はんだ付け作業にともなうランニングコストが高 30くなり易い。

【0015】その他、図5に示すような関口面積が大きいノズル51を使用するガスカーテン技術においては、 噴出するガス圧を低くできる反面、封止性が低く、大量 のガスを噴出させないとノズル間隔も広くできないという短所がある。

【0016】また、特開平5-185272号公報の技術においては、次のような問題点がある。すなわち、一方の遠流装置のみが作勁している場合においては、その吸引と噴出による(入口側あるいは出口側の何れか一方40へ向かう)雰囲気流勁がチャンパ内に発生し、それに伴ってチャンパ内雰囲気の酸素浪度分布が変化することになる。また、チャンパ内雰囲気の温度分布も変化することになる。すなわち、配線基板に対する温度プロファイルも変化することになる。

【0017】前記の現象は、双方の還流装置が作動している場合にも発生する。すなわち、両湿流装置の湿流流 量が不平筒状態にある場合には、同様の理由により入口 側あるいは出口側の何れか一方へ向かう穿囲気流動がチャンパ内に発生するからである。したがって、両覆流装 50 図の還流量の平衡を採ることがこの技術においては重要 となる。

【0018】その他、同公報の技術においては、巨大な 予備室が必要であり、その存在がはんだ付け装置全体の 雰囲気の封止性を向上させているもう1つの要因となっ ている。しかし、予備室の存在は、はんだ付け装置の大 型化を招くこととなる。

【0019】本発明は、従来技術における上記のような問題点を解消し、不活性ガス(窒素ガス)の消費量を最小限に抑えつつチャンパ内の雰囲気の封止性を高めるとともに、酸素減度や温度を安定に保持することによって、優れたはんだ付け環境を低ランニングコストで可能とするはんだ付け装置を得ることを目的とする。

#### [0020]

【課題を解決するための手段】本発明にかかるはんだ付け装置は、フラックスヒューム除去後の雰囲気をガスカーテン形成用のガスとして使用しているところに特徴がある。

【0021】本発明は、フラックスヒューム除去後のガス体を噴出してガスカーテンを形成するノズルを備えた ものである。

【0022】また、少なくともチャンパの出口側を封止 するガスカーテンを形成するノズルを備えたものであ る。

【0023】さらに、捕集装置は雰囲気を冷却するための冷却部を有するものである。

【0025】さらに、ノズルは長尺状の管体からなり、ガス噴出用の針状の孔が所定間隔で形成されるとともに、ガス噴出用の孔が対抗する向きで、その長手方向が互いに水平方向で120mm以下の間隔で配設され、他方、フラックスヒュームの捕集装置を介してチャンパ内の雰囲気を吸引してノズルから吐出するガス体の吐出静圧が800mmAq以上の出力を有するポンプを備えたものである。なお、ガス噴出用ノズルとして、フィルム状の開口スリットを形成したノズルを使用しやもよい。

#### [0026]

【作用】本発明においては、チャンパを封止する目的で使用するガスカーテンを配設する位置は、一般的にチャンパの開口部や被処理物(配線基板)の出入口であり、そのため当該部位における酸素浸度はチャンパ内と比較して高い。したがって、ガスカーテンに不活性ガスの生ガスを供給する必要はなく、フラックスヒューム除去後の不活性ガスを含む雰囲気で、十分にその役割を果すことができる。

【0027】なお、チャンパの関口全てに(出入口に)

5

それぞれ前記ガスカーテンを配設すれば最も封止性が高まるが、配線基板の搬送にともなって雰囲気の漏出、流出しやすい配線基板の扱送出口側にガスカーテンを配設するだけでも十分な封止性が得られる。

[0028]逆に、配線基板の搬送方向とは逆方向に雰囲気が流動するように不活性ガスの供給、噴出方向を制御して封止性の低下を抑制する技術を用いたはんだ付け装置にあっては、その入口からチャンパ内の雰囲気がわずかずつ流出する。したがって、このようなはんだ付け装置にあっては、配線基板の搬送入口側にガスカーテン 10 を配設するだけでも十分な封止性が得られる。

【0029】また、フィルタリングによってフラックス ヒュームを除去した雰囲気はフィルタリングにおいて冷 却しているので、配線基板がガスカーテンを通過する際 に配線基板の冷却も行うことができる。なお、フラック スヒュームを除去する補築装置が雰囲気の冷却を行う冷 却部を備えている場合においては、液冷却によって雰囲 気の密度が更に高まり、ガスカーテンの封止性が一層高 まるとともに、配線基板の冷却を一層効果的に行うこと ができる。

【0030】他方で、このような冷却した雰囲気をチャンパ内へ直接に還流させることがないので、チャンパ内 雰囲気ガスの温度を冷却する外乱要因となることもない。さらに、フラックスヒューム除去装置は一定で安定した流量の雰囲気凝流を行うので、チャンパ内の雰囲気の流動状態が変則的に変化することもなく、安定した状態に保持することができる。

【0031】また、ラビリンス部を形成する抑止板の間にガスカーテンを形成することによって、ガスカーテン形成位置における雰囲気の酸素濃度に対して、十分に低 30酸素濃度の穿囲気を得ることが可能であり、また、ガスカーテン形成に伴う不要な雰囲気の流動を生ずることもない。

【0032】なお、ガス噴出用の針状の孔を列設したノズルでガスカーテンを形成する場合にあっては、ガス体の吐出停圧を800mmAq以上の出力を有するポンプを使用することで、ノズル間隔120mm以下において、針状の最小なガス噴出用の孔でもガスカーテン形成に必要なガス噴出速度を得ることができる。すなわち、封止性の良いガスカーテンを形成することができる。こ 40のことは、フィルム状のスリットで形成したノズルにおいても同様である。

[0033]

【実施例】次に、本発明のはんだ付け装置の実施例を説明する。図1は本発明の第1の実施例を示す側断面図で、本発明をリフロー型はんだ付け装置に適用した場合を説明するものである。

【0034】この図において、1は配線基板で、数送コ テンを形 ンペア2により、矢印A方向に放送される。3はチャン 不必要な3 パで、上部チャンパ3A, 下部チャンパ3Bにより編成 50 傾される。

されている。4はラビリンス部、5は第1のプリヒート部、6は第2のプリヒート部、7はリフロー部、8はラビリンス部を示し、9はヒータ、10はラビリンス部を形成する抑止板、11,12は前配配線基板1を搬入し、設出するためチャンパ3に形成した入口と出口である。このように、第1,第2のプリヒータ部5,6の後工程にリフロー部7を備えている。そして、これらのチャンパの入口11と出口12には、配線基板1が搬送される方向に対して交差する方向に板面が並び、すなわち雰囲気流動を抑止する抑止板10を設送コンペア2を挟んで配設したラビリンス部4,8が形成されている。

【0035】一方、窒素が封入された不活性ガス供給タンク13から配管14により開閉弁15および流量網節 弁16を介してチャンパ3の各部分へ不活性ガス供給ロ 17から窒素ガスを供給し、目的とする酸素濃度となる ように不活性ガス(窒素ガス)供給流量を調節する柄成 である。

【0036】他方、フラックスヒュームの発生が最も多 いリフロー部7の雰囲気を形成するガス体を吸込口筺1 8から配管部19を介して捕集装置20に吸引し、この 捕集装置20の冷却部21でガスの冷却を行ってフラッ クスヒュームを凝結させ、フィルタ部22で雰囲気ガス 中のフラックスヒュームを効率よく捕集・除去してガス 体とする構成である。なお、ガス体の吸引力は、ガス体 の循環する方向に対し、捕集装置20の前段側に配設し たポンプ23、例えばターポプロアやリングプロー等で 発生する。 そして吐出するガス体は、出口12側のラビ リンス部8の抑止板10の間に撥送コンペア2を挟んで 配設したノズル24から噴出させ、ガスカーテンを形成 する構成である。この例のように、出口12側のラビリ ンス部8内にノズル24を設けたのは、リフロ一部7内 の不活性ガスの浪度が高い(酸素温度が低い)ことと、 配線基板 1 と搬送コンペア 2 とが矢印A方向、すなわち 出口12側に向って走行し、かつ、不活性ガスもそれに 引きずられて、出口12側から流出されやすいためであ る。なお、ノズル24は出口12の他に入口11側のラ ビリンス部4内にも設けてもよい。すなわち、チャンパ 3内の雰囲気が流出しやすい部分、また、流出を防止し たい部分に設ければよい。

【0037】次に、効作について説明する。このようにしてガスカーテンを形成することによって、出口12側のラビリンス部8にとっては十分に低い酸素濃度のガスカーテンを形成することができる。すなわち、リフロー部7のチャンパ3内における酸素濃度を100ppm程度に保持する場合、ラビリンス部8における酸素濃度は50%増程度の150ppmとなるので十分である。

[0038] このように、ラビリンス部8内にガスカーテンを形成することによって、ガスカーテン形成に伴う不必要な分田気流跡がチャンパ3内に発生することが抑制される。

【0039】そして、フィルタリングで冷却したことに よって密度の高くなったガス体がノズル24から噴出す るので、当該、ガスカーテンの封止性が良好となる。ま た、ガスカーテン領域を配線基板1が通過する際に配線 基板1を冷却することもできる。

. 7

【0040】他方、チャンバ3内の酸素浸度は、前記の ガスカーテンの吐出風量(流量)とは独立に不活性ガス の流量調節弁16で調節するので、チャンパ3内の酸素 **湿度の制御性も良好である。** 

【0041】図2は図1のノズル24の形状を示す斜視 10 図である。ノズル24は長尺状で上下一対のパイプ25 からなり、各パイプ2.5にはガス体を噴出する孔2.6が それぞれ形成されている。パイプ25は、その長尺方向 が水平方向となるように配設されている。

【0042】すなわち、ノズル24は上下のパイプ25 の間隔D=120mmとして孔26を対向して設けた棉 成であり、一例として孔26の孔径はd=1.5mmの 針状またはピンホール状の孔で、孔26の間隔S=10 mm、パイプ25の肉厚t=1.2mmとして構成した ものである。したがって、ガスカーテンは両ノズル24 20 間に形成される。ちなみに、ノズル24の長さレ=54 0 mmで孔26の全数を両ノズル合計でN=100 個と した。なお、孔26の間隔5の値を必要以上に小さくし て孔26の数を増加させても、カーテン作用、すなわち ガスカーテンとしての封止性はそれほど向上しない。

【0043】ところで、ガスカーテン形成用のノズル2 4としては、孔26の径を小さくしたものの方がカーテ ン作用(封止性)に優れているので、これに対応して不 括性ガスの吸引および吐出源となるポンプ23には、目 的とする風景における吐出静圧の高い出力を有するポン 30 プ23を使用することが必須である。すなわち、これに よって高圧少風景の良好なガスカーテンが形成できる。 低圧大風景のガスカーテンは、チャンパ3内の雰囲気ガ スの流効に与える影響が大きくなり雰囲気の封止性が逆 に悪くなり易いからである。

【0044】なお、図3に例示するように孔としてスリ ット26Aを設けたノズル24であっても良いが、スリ ット26Aの間隙を従来よりも極めて狭くし、フィルム 状のスリットに桐成する必要がある。この例において は、スリット26Aの間隙を0.8mmで実施した。

【0045】ポンプ23としては、プロアやファンの分 野で一般的に高圧型と呼ばれるものを用いる。例えば、 低圧型のプロアファンでは、その吐出静圧が数10mm Ag程度であるが、本実施例では、吐出停圧が900m Ag以上得られるところのポンプ (リングプロー型ポン プ) を使用した。なお、本実施例においては、その吐出 風量は0.2m³/min以下である。

【0046】以上のようなポンプ23およびノズル24 を使用することによって、チャンパ3内の雰囲気ガス循 ことができる。すなわち、孔26から噴出するガス体の カーテン厚を小さくし、かつ噴出速度を速くすることが できるからである。

【0047】本実施例では、以上のような構成とするこ とによって(ポンプ23の静圧約960mmAq、風量 約0.2m³/min)、ガスカーテンに窒素の生ガス を供給した際と同等の雰囲気封止性(一例として本出願 人の日本電熱計器 (株) 製の基板幅最大350mmまで 対応するN:リフローはんだ付け装置において、チャン パ内への窒素ガス供給流量約15m³/h, チャンパ内 酸素濃度約100ppm)を確保している。なお、従来 どおりに、ガスカーテンに窒素の生ガスを供給するなら ば、はんだ付け装置全体としての窒素ガス消費量は、さ らに約6m1/h程度増加する。そして、本実施例と同 等の配線基板の冷却能力を得ようとするならば約12m 5 /h程度増加する。

【0048】そして、図1のポンプ23の吐出静圧が約 800mmAq以上あると、図2に示すように孔径d= 1. 5 mm以下の微小な孔26であっても十分なガス噴 出速度が得られ、ノズル間隔D=120mm以下であれ ば良好なガスカーテンを形成できることが判明した。な お、ノズル間隔Dは、配線基板1および配線基板1に搭 競される電子部品の搭競高さに対して十分な余裕をもっ て選定し設計した値であり、一般的な配線基板1であれ ば間隔D=120mmを越えることはない。

【0049】このように、微小な孔26からガスを噴出 させてガスカーテンを形成する際には、良好な封止性を 得る上ではポンプ23からのガス体の吐出静圧とノズル 間隔が規定的因子として作用する。すなわち、低圧型ポ ンプで噴出孔径の大きいガスカーテンでは封止性が低く なり易いからである。

【0050】また、ノズル24の孔26からのガス休の 噴出具はその孔径はにも規定されるが、噴出速度は主と してポンプ23からの吐出静圧に規定される。したがっ て、孔径dを大きくすればガス体の吐出液量は大きくな るが、カーテン作用すなわち封止性が格段に向上するこ とはない。むしろ周辺の雰囲気を巻き込む不必要な雰囲 気流動を生じたり、チャンパ3からガスカーテンに供給 される雰囲気の流量が増加し、結果的に封止性が低下し てチャンパ3への不活性ガス供給流量を増加させる必要 を生ずることになる。そのため、むやみにノズル24の 孔26の孔径 dを大きくすることはできない。

【0051】以上のように、少ないガス噴出量で封止性 の優れたガスカーテンを形成するには、ガスカーテンの 状態を規定する主囚子の数値選定が特に重要である。

【0052】図4は、本発明の第2の実施例を示す側断 面図で、本発明をフロー型はんだ付け装置に適用した場 合を説明するものである。この図において、図1と同一 符号は同一部分を示し、フロー型はんだ付け装置におい **環鼠を増加することなく十分なガスカーテンを形成する 50 ても、その基本的な构成は同様であり、チャンパ31は** 

-195-

上部チャンパ31Aと下部チャンパ31Bからなる。ト ンネル状のチャンパ31にプリヒート部33およびフロ 一はんだ付け部34を配設して構成する。そして、チャ ンパ31内を通過するように配線基板1の機送コンペア ・2を設け、また、チャンパ31の入口11と出口12に はそれぞれラビリンス部32、35を形成している。

[0053] また、36ははんだ槽、37ははんだ融 液、38は噴流帽、39は噴流波、40はブリヒータ、 41は前記各ラビリンス部32,35の抑止板、42は 前記プリヒート部33, フローはんだ付け部34に設け 10 た抑止板、43は不活性ガスを噴出するノズルである。

【0054】一方、不活性ガス供給タンク13から開閉 弁15および流量調節弁16を介して不活性ガスを供給 する。そして供給位置は、矢印A方向に扱送される配線 基板1がはんだ融液37に接触する位置に対して前段側 で、配線基板1の撤送方向(矢印A方向)とは逆方向へ ノズル43を向けて配設する。こうすることで、 扱送コ ンペア2の走行方向へ流勁しようとする雰囲気の流れ を、ノズルイ3から噴出する不活性ガスの流れが押し止 め、雰囲気の流動が平衡して封止性を高めることができ る。このため、不活性ガスの浪度はフローはんだ付け部 34で最も高くなる。

【0055】他方、フラックスヒュームの発生が最も多 いはんだ稽36の上側に吸込口憶18を配設してフラッ クスヒュームを捕集装置20に吸引し、捕集・除去する 枠成である。前記の雰囲気ガスの吸引力は、ポンプ23 で発生する。そして、噴出するガス体は出口12側のラ ビリンス部35の抑止板41の間に撥送コンペア2を挟 んで配散したノズル24から噴出させ、ガスカーテンを 形成する構成である。

【0056】なお、ガスカーテンを形成するノズル24 は図1のリフロー型と同様に出口12例のラビリンス部 35に設けたが、出口12側の他に入口11側のラビリ ンス部32内に設けてもよい。

【0057】図4のフロー型はんだ付け装置においても その動作は図1のリフロー型はんだ付け装置と同様であ る。すなわち、このようにしてガスカーテンを形成する ことによって、出口12側のラビリンス部35にとって は十分に低い酸素温度のガスカーテンを形成することが できる。また、フィルタリングによって冷却して密度の 40 高まった雰囲気ガスをノズル24から噴出させるので、 ガスカーテンの封止性が向上するとともにガスカーテン 領域を配線基板 1 が通過する際に配線基板 1 を冷却する こともできる。そして、チャンパ31内の酸素凝度の制 御性も良好である。その他、ポンプ23およびノズル2 4の构成および作動についても、図1のリフロー型と同 様である。

[0058]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、フラック スヒューム除去後のガス体を噴出してチャンパを封止す 50 11

るガスカーテンを形成するノズルを備えたので、不活性 ガスの消費量が少ないにもかかわらず雰囲気ガスの封止 性を良好に保持することができ、チャンパ内の酸素濃度 の制御性にも優れている。

10

[0059] そして、少なくともチャンパの出口側を封 止するので、基板の冷却も併せて行うことができる。

【0060】また、捕集装置は雰囲気を冷却するための 冷却部を有するので、フラックスヒュームのフィルタリ ングにともなってガス体が冷却してガス譲度が高くな る。そのため、ガスカーテンの封止性が高まるととも に、ガスカーテン領域を配線基板が通過する際に配線基 板を冷却することもできる。

【0061】そして、冷却した雰囲気をリフロー部のチ ャンパ内に湿流させることがないので、リフロー型はん だ付け装置では、特にチャンパ内雰囲気温度に外乱を与 えることがなく、雰囲気温度ひいては配線基板の温度プ ロファイルの制御性も良好となる。

【0062】また、チャンパはその出口側に配線基板を 松送するコンペアを挟んでラビリンス流路を形成する抑 20 止板が複数並設して備えられるとともに、抑止板と抑止 板との間にガスカーテンを形成するノズルが配設された ので、ガスカーテン形成に伴って不必要な雰囲気ガスの 統励を生ずることがなく、不活性ガスの封止性を一層向 hすることができる。

{0063} また、ノズルは長尺状の管体からなり、ガ ス噴出用の針状の孔が所定間隔で形成されるか、また は、フィルム状スリットを形成するとともにガス噴出用 の孔が上下に対向する方向で、その長手方向が互いに水 平方向で120mm以下の間隔で配設され、他方、フラ ックスヒュームの捕集装置を介してチャンパ内の雰囲気 を吸引してノズルから吐出するガス体の吐出静圧が80 0mmAq以上の出力を有するポンプを備えたので、少 ないガスの吐出量で優れた封止性を得ることができる等 の利点を有する。

### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1の実施例を示す側断面図である。
- 【図2】図1のノズルの形状を示す斜視図である。
- 【図3】図1のノズルの他の形状を示す斜視図である。
- 【図4】本発明の第2の実施例を示す側断面図である。
- 【図 5】低圧型プロアでガスカーテンを形成するときに 使用するノズルの従来例を示す斜視図である。

#### 【符号の説明】

- 1 配線基板
- 2 協送コンペア
- 3 チャンパ
- ラビリンス部
- リフロー部
- 8 ラビリンス部
- 10 抑止板

*30* 

(7)

特開平7-212031

11

18 不括性ガス供給タンク

12 出口

13 不活性ガス供給タンク

18 吸込口質

20 捕集装置

2 1 冷却部

22 フィルタ部

23 ポンプ

24 ノズル

25 パイプ

26 孔

26A フィルム状のスリット

12

| 配脚基板 8 ラビリンス部 18 砂込口板 24 ノズル 25 撮影コンペア 10 抑止板 20 始集教室 3 チャンペ 11 人匠 21 冷却部 4 ラビリンス都 12 出匠 22 フィルタ部

